## メカノケミカル処理した原料を用いたスピネル生成反応の熱分析

### 芦田 利文

# Thermal analysis of formation of spinel from raw materials activated mechanochemically

### Toshifumi ASHIDA

Mixture of low crystalline magnesia and  $\chi$  -alumina which was activated mechanochemically was measured from 700 °C to 900 °C by differential thermal analysis(DTA) with the view to investigation of process of spinel formation. Exothermic reaction of the formation was measured by isothermal heating at the temperatures. At all temperatures exothermic heat was observed for about 10000 seconds and after the reaction DTA curve changed linearly. Heat contents calculated from DTA curves increased with isothermal temperature from 700 to 850 °C. Decrease of heat at 900 °C indicated that reaction started below the isothermal temperature. When reaction ratios were evaluated from each heat contents, spinel reactions were analyzed by Kolmorgov-Avrami model. According to the Avrami's parameters, below 800 °C, reaction was dominated by one or two dimensional domain interface diffusion, whereas above 850 °C three dimensional diffusion became dominant.

Key words: mechanochemical process, thermal analysis, isothermal measurement

#### 1.緒言

既報<sup>1)</sup>において,筆者は結晶性の低い MgO と遷移 アルミナ(γアルミナ, χアルミナ)を粉砕混合し,メ カノケミカル反応により粉体の反応性を向上させれば, 600℃で 24 時間焼成するとスピネル(MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)が生成 し,800℃以上でほぼ単一相となることを報告した. MgO と Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>組成の混合物を焼成すると,通常1200℃ 以上必要な焼成温度が,大きく低下したことは,粒子 形状の制御など今後のスピネルの合成プロセスを考え る上で興味深い.報告の中で,示差走査型熱分析装置 (DTA)を用いて熱分析手法により生成過程を検討し たところ,通常の昇温法によっては反応速度が遅いた め、スピネル生成に伴う熱変化が捉えられなかったが、 所定の温度で16時間時間恒温測定をしたところ、ス ピネル生成によると思われる発熱の熱変化が捉えられ ていることが示唆された.スピネルの生成プロセスに 関するより詳しい情報が得られれば、粒子径や形状な どを制御するための情報として資すると考えられる.

反応熱などの熱変化を分析する手法として,示差走 査型熱量計(DSC)が広く用いられている.しかしなが ら,今回のスピネルの生成反応のように,600℃以上 の高温まで測定できる DSC は数少なく,測定が困難 である.今回の研究では,定量性を検討した上で,示 差熱分析装置(DTA)を用いて反応過程を検討した.測

近畿大学工学部 化学生命工学科 Department of Biotechnology and Chemistry, Faculty of Engineering, Kinki University

定には,軽質マグネシア(低結晶性 MgO)と遷移アル ミナ( $\chi$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を192時間メカノケミカル反応させた 試料を供した.この試料を DTA 装置により,700℃か ら 900℃までの所定の温度で120時間(5日間)保持し, その間の熱変化を測定した.

#### 2.実験方法

塩基性炭酸マグネシウムを熱分解し作成した軽質  $MgO(低結晶性 MgO) と_{\chi} アルミナをモル比1:1のスピネル組成で混合し、遊星ボールミルを用いて192時間 粉砕した.得られた混合試料の粉末 X線回折図を図1 に示す.図にみられるように、室温の粉砕により、スピネルがわずかに生成している.この試料を DTA 測定に供した.$ 



Fig.1 XRD profile of sample milling for 192hr. •:spinel,  $\Box$ :MgO,  $\nabla$ : $\chi$ -alumina,  $\diamondsuit$ :WC

示差走査型熱分析装置には,島津 DTA-50 を用いた. この装置の精度を,水酸化カルシウム並びに炭酸カル シウムの熱分解に伴う吸熱ピークの面積を用いて,熱 量との関係により見積もった.ピーク面積は,時間に 対する DTA 信号を積分して求めた(単位:mV.sec). 測定条件は,大気雰囲気,10℃/minの昇温条件とし, それぞれ 3 回ずつ測定して,平均値を更正に用いた. 分解熱の値は,JANAF テーブル<sup>23</sup>より,

 $Ca(OH)_2 \rightarrow CaO+H_2O$   $\Delta H=109.24$  kJ/mol CaCO<sub>3</sub> $\rightarrow$ CaO+CO<sub>2</sub>  $\Delta H=117.8$  kJ/mol を用いた.

反応温度は水酸化カルシウムの場合 450-470℃,炭酸カルシウムの場合 670-820℃と異なるが、ピーク面積(mV×秒)と反応熱(J)との更正係数の値は、それぞれ 20.66 J/mV.sec および 20.68 J/mV.sec とほぼ等しく,熱量の定量が可能であると判断した.

試料の DTA 測定では, 試料容器に白金の皿を, 基 準物質側に α アルミナ 20mg を用いた. 測定試料 20.0mg を大気雰囲気で 700℃から 900℃の範囲で測 定した. 所定の温度まで, 10℃/min で昇温し, 所定の 温度(700℃, 750℃, 800℃, 850℃, 900℃)で 120 時 間(4.32×10<sup>5</sup> sec)保持した. 熱分析後の試料を回収し, Si 無反射板を用い粉末 X線回折法により, 反応後の試 料の組成を確認した. 3.結果と考察

DTA 測定後の試料の粉末 X線回折図を図 2 に示す. 試料量が少ないためバックグランドの変動がやや高い が, どの温度で測定した試料についてもスピネルが主 成分であることがわかる. 既報の 24 時間電気炉で焼 成処理した試料と比較すると, DTA 測定では 120 時 間処理をしているため, 800℃以下では回折線の強度 が 24 時間熱処理したものよりも大きい. 800℃℃以下 では 24 時間後もスピネルの生成反応,ならびに結晶 化が継続していると考えられる.



Fig.2 XRD profiles of samples after DTA measurements. Figures of each profile indicate temperatures of isothermal DTA measurements. ●:spinel

図3に、10℃/minで昇温後750℃で120時間恒温 測定をした標準試料(aアルミナ)のDTAカーブを示す. 横軸は経過時間であり、恒温測定直前の700℃から恒 温が終わり昇温に移行した後の795℃までの範囲を示 している.プログラムでは750℃で恒温測定としてい るが、恒温開始時には765℃まで上昇した後に、15分 後には759℃で一定温度となった.開始時のオーバー シュート区間を含む平均温度は759.6±0.6℃であった. 図に示すように試料に相変化などの熱変化がない場合 DTAカーブはほぼ水平で、その変動幅は、オーバーシ ュートした温度が一定となりDTAカーブが水平に移 行した恒温開始15分後から終了時までの間で標準偏 差として 0.01µV以下であった.メカノケミカル混合 した試料の反応に起因した熱量による温度変化がこの 変動幅以上であると測定可能と考えられる.



Fig.3 DTA curve of  $\alpha$  -alumina.

Temperature is held at 750  $^\circ \! \rm C.$  X-axis indicates duration from 700  $^\circ \! \rm C.$ 



Fig.4 DTA curve of sample held at 700  $^\circ\!\mathrm{C}$  for 100 hr.



Fig.5 DTA curve of sample held at 750  $^\circ\!\mathrm{C}$  for 120 hr.



Fig.6 DTA curve of sample held at 800  $^\circ\!\!\mathrm{C}$  for 120 hr.



Fig.7 DTA curve of sample held at 800  $^\circ\!\! C$  for 120 hr.



Fig.8 DTA curve of sample held at 800  $^\circ\!\mathrm{C}$  for 120 hr.

図4から図8に各温度で測定した試料のDTA曲線 を示す.なお、700℃の測定は、装置が不安定であっ たため100時間恒温測定したデータである.昇温過程 から恒温過程に移行した際に、DTA信号は急激に減少 する.この過程は標準試料を測定した場合と同様であ り、その際の最下部の値は、反応前の試料のベースラ インとなる位置と考えられる.標準試料の測定と測定 試料の測定との間のベースラインの値の差異は、試料 の熱容量差、あるいは試料表面からの放熱効率の差を 表していると考えられる.

各試料ともに、恒温過程に入った瞬間のベースラインの位置から、約 10000 秒(~28 時間)の間は緩やかに 発熱を示す正の方向に DTA 信号は移行した. 結晶性 のマグネシアとαアルミナおよびγアルミナからスピ ネルへの反応エンタルピー(T=298 K)は、

 $\begin{array}{ll} MgO+ \alpha \ Al_2O_3 \rightarrow MgAl_2O_4 & \Delta \ H=-22.18 \ kJ/mol \\ MgO+ \gamma \ Al_2O_3 \rightarrow MgAl_2O_4 & \Delta \ H=-41.02 \ kJ/mol \end{array}$ 

とそれぞれ発熱反応となっている<sup>2</sup>. 今回の場合,低 結晶性のマグネシアと, $\gamma$ アルミナと同程度がそれ以 上に結晶性の低い $\chi$ アルミナを用いていること,さら に粉砕により XRD 的には結晶性が出発原料よりも低 下していることなどから,測定に用いた試料の内部エ ネルギーはより高くなっていることが予想される.したがって、DTA 測定で得られた発熱側へのDTA 曲線の移行は、スピネルの生成過程に対応していると考えられる.また、測定温度が高くなるとともに、発熱側への変動が大きくなっていることから、温度上昇とともにスピネルの生成量が増加していることに対応していると考えられる.

恒温測定初期にみられる発熱側への移行過程の後 に, DTA 信号は直線的に変化した. 理論的にはスピネ ル生成反応が終了すると、熱の発生がなくなるため DTA 信号は標準試料のようにほぼ水平になるはずで あるが、傾きを持つ直線となった.これは、反応熱を ほとんど伴わない変化、たとえば結晶成長などにより 緩やかに結晶化が進行しているためではないかと推察 される. また,標準試料に比べて DTA 信号に乱れが みられているのは,スピネルの生成反応は固相反応で あるため、接触などの幾何的要因が反応の進行に影響 し、不均一に反応が進行しているためと考えられる. この直線部における反応の割合は見積もることが難し く、また DTA 信号を見る限りそれほど多くないと仮 定し、DTA 信号の直線部を直線近似し、直線からのず れの大きくなる点を初期の反応の終点と考え、各図に 示すようにベースラインを描きその面積から、更正定 数 20.66 J/mV.sec を用いて, 各温度における反応熱を 見積もった(表 1). なお, 750℃測定にみられる DTA 曲線上のピークは、何らかの不純物と考え、面積の算 出からは取り除いた.

Table 1 Heat content calculated from DTA curve.

Temp. /°C	700	750	800	850	900
Duration /10 <sup>3</sup> sec	3.6- 120	2.9- 121	2.5- 100	1.0- 98	0.66- 98
Heat /kJ/mol	510	808	1345	2140	1151

スピネル生成による発熱量に対応する面積は, 850℃までは DTA 測定温度が高くなるにつれて大き くなった.このことはこの区間におけるスピネルの生 成量と直接対応していると考えられる.一方,さらに 高温の 900 ℃では熱量は減少した.これは,今回の解 析では恒温過程に移行した直後の DTA 信号の最小位 置,すなわち恒温後約 10~60 分後を反応開始点と考 えているが,900 ℃で恒温した場合,900℃までの昇 温過程ならびに恒温直後から開始点までの間に一定量 の試料がスピネルへと転移しているため,発熱量が小 さくなったと考えられる.熱量を換算したところ,ど の試料についても大きな値となった.これは,粉砕に よって試料に大きなエネルギーが蓄えられたためと考 えられる.

試料の発熱量は、スピネルの生成量と対応している ため、発熱にともなう DTA のピーク面積を時間に対 してプロットした(図 9). 図より、DTA の恒温温度を 上昇させるとともに、立ち上がりが速くなり反応速度 が上昇していることがわかる.



Fig.9 Change of areas of calorific heat of DTA curves with time. Samples are held at each temperature.

固相反応においても、1 次核発生と成長のモデルに より、多くの反応過程が説明できる<sup>3)</sup>. そこで、 Kolmorgov-Avrami モデルにより、時間に対する DTA 曲線の面積の変化を解析した. ここでは、表1に示し た各温度の最終的な面積が異なることから、積分終了 時の面積がその温度における生成量と対応していると 考え、積分終了時の面積で時間ごとの面積を規格化し、 Avrami 式に適用した. Avrami 式は次のように書ける.

$$\frac{S(t)}{S_{f}} = 1 - exp(-At^{k})$$
 (1)  
t:積分開始からの経過時間 秒  
S(t):t秒後の積分面積  
Sf:積分終了時の面積  
A:活性化エネルギーに関連したパラメータ  
k:Avramiのパラメータ(反応進行の次元に関連し  
ているとされる).

測定した面積から, A,k を決定するため(1)式を次の ように変形した. なお S(t)/S<sub>f</sub>を I と置いた

$$1 - I = \exp(-At^k)$$

 $log_e(1-I) = -At^k$ 

 $log_e(log_e(1-l)^{-1}) = log_eA + klog_et$ (2)

(2)式より横軸に log<sub>e</sub>(t) 縦軸に log<sub>e</sub>(log<sub>e</sub>(1-I)<sup>-1</sup>)を取 ってプロットした(図 10). なお曲線が重なるため,水 平方向にずらしてプロットしている. これらの直線近 似による傾きが Avrami のパラメータ k を, y 切片が log<sub>e</sub>A を示している.



Fig.10 Avrami plot calculated from area of DTA curve.

この結果,800 ℃,850 ℃以外の生成量については, 反応初期の7000 sec 付近までとそれ以降とでは,異な る直線で近似できることがわかった.図 10 から求め られた A,ならびに k の値を表 2 に示す.

Table 2 Avrami parameters calculated from DTA curves.

Temp.	Initial	Initial region		Main region		
/°C	A/10 <sup>-6</sup>	k	A/10 <sup>-9</sup>	k		
700	1.37	1.10	3.40	1.80		
750	1.53	0.940	2.00	1.83		
800			1.76	1.88		
850			19.4	1.62		
900	0.059	1.70	799	1.35		

Avramiのパラメータkの値は、核生成機構、成長 機構、ドメイン形状を表しているとされる.反応を固 相反応に一般的な不均一核生成によるモデルで考える と、700℃、750℃では反応初期には.Avramiのパラ メータは1に近く、界面成長による1次元的な形状で 成長していると推察される.スピネル相の成長は時間 経過とともに Avramiのパラメターの値が2に近づき 界面成長によるディスク状の成長へと移行しているこ とが予想される.

800℃では、温度が高いため恒温前に界面の1次元

的な成長は終了しており、恒温過程でディスク状の成 長が観測されたと考えられる.

さらに、850℃、900℃では、Avramiのパラメター は 1.5 に近づき、温度がさらに高くなり原子の拡散が 容易になったため、ドメインの成長は界面成長から拡 散による球状の形状へと変化しているのではないかと 考えられる.このことは、900℃の DTA 測定後の試料 の粉末線回折図(図 2)では、スピネルの成長面と考えら れる 440 回折線強度が低下し、標準的なスピネルの回 折線強度 (JCPDS カード 21-1152) にまで低下してい ることとも符合している.

参考文献

1.芦田 利文, 小屋 貴嗣, 高橋 祐介, 近畿大学工 学部研究報告, No.46, 25·30(2012)

2.M. W. Chase, Jr., C. A. Davies, J. R. Downey, Jr., D. J. Frurip, R. A. McDonald, and A. N. Syverud. J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol.14, Suppl.1(1985) 3.小岩 昌宏, まてりあ, vol.50, 55-62(2011)